

조 손 선<sup>1</sup>, 이 주희<sup>2</sup>  
경희대학교 전자공학과

The Effect of N<sub>2</sub> Molecules on Kinetics of Pulsed CO<sub>2</sub> Laser

CHO, SOON - CHEON<sup>1</sup>, LEE, CHOO - HEE<sup>2</sup>  
Dept. of Electronic Eng., Graduate School Kyung Hee University

Abstract

Theoretical studies of concentration for negative ion and neutral species in electrical excitation discharge have been conducted at CO<sub>2</sub>-N<sub>2</sub>-He=1-7-12, total pressure 20torr. With a computer model of neutral and negative ion processes we have calculated that the concentration of co was less than 20% when expected molecular.

I. 서론

전기 방전에서 CO<sub>2</sub> 레이저는 최근 가공 및 군사용의 대중화으로부터 의료용과 같은 저출력까지 폭넓게 응용되고[1-2] 있음은 잘 알려져 있으며 이렇게 응용되는 레이저는 대부분은 Sealed-off 형태를 사용하고 있다. 그러나 Sealed-off 형태를 사용할 때 전자와의 충돌에 의한 해피반응으로 인하여 생성되는 분자와 해피분자에 전자의 부작으로 쉽게 생성되는 충돌이온 등이 계속 축적되므로 출력을 감소시키며 방전특성을 불안정하게 하는 등의 문제점[3]이 제시되어 왔으며 이러한 문제점을 해결하기 위하여 상당히 많은 연구[4-6]들이 활발히 진행되어 왔었다.

J.F.Prince[6] 등은 저압력(~20 torr)의 CO<sub>2</sub>-N<sub>2</sub>-He 혼합가스에서 중요한 충돌은 중성(NH<sub>3</sub>, O<sub>2</sub>, CO<sub>2</sub> 등) 물질을 관찰하였으며 H<sub>2</sub>와 CO<sub>2</sub> 분자를 혼합가스에 첨가로 CO<sub>2</sub> 분자의 해피평형(Dissociation Equilibrium)을 할 수 있다고 [8] 제시하였다.

본 논문에서는 CO<sub>2</sub>-N<sub>2</sub>-He 혼합가스에서 N<sub>2</sub>분자에 대한 영향을 투시한 수밀도를 계산하여 N<sub>2</sub>분자를 포함하였을 때의 사이를 비교하여 수밀도에 대한 N<sub>2</sub>분자의 영향을 조사하였다.

II. 본론

CO<sub>2</sub> 레이저의 CO<sub>2</sub>-N<sub>2</sub>-He 혼합가스는 CO<sub>2</sub>와 N<sub>2</sub>분자가 전자와의 충돌에 의해 CO<sub>2</sub>, 그리고 N<sub>2</sub>분자가 생성되는 해피반응과 해피분자와 전자와의 부작(Attachment)에 의한 충돌이온 생성반응이 일어나 처음의 CO<sub>2</sub>-N<sub>2</sub>-He가스 분자이외에 많은 중性的 분자(CO, O, N, N<sub>2</sub>, NO, NO<sub>2</sub> 등)와 음이온(CO<sub>3</sub><sup>-</sup>, CO<sub>4</sub><sup>-</sup>, O<sup>-</sup>, O<sub>3</sub><sup>-</sup> 등) 등을 포함한 혼합된다. 이러한 많은 중性的 생성분자 및 이온들을 해석하기 위하여 이온화, 해피, 해피부작, 재결합, 이탈등의 반응을 고려하였으며 표1에 나타내었다.

Table 1. The various reaction and their typical rate constant used for calculation  
T<sub>g</sub> = 300 K; T<sub>c</sub> = 1 eV

REACTION	RATE CONSTANT	SOURCE
Dissociation attachment		
CO <sub>2</sub> + e → CO + O <sup>-</sup>	K <sub>1</sub> = 5.0 E-13	
O <sub>2</sub> + e → O + O <sup>-</sup>	K <sub>2</sub> = 3.0 E-12	[7]
Negative ion detachment		
CO + O <sup>-</sup> → CO <sub>2</sub> + e	K <sub>3</sub> = 7.0 E-10	
O <sup>-</sup> + O → O <sub>2</sub> + e	K <sub>4</sub> = 2.0 E-10	
CO <sub>2</sub> + O → 2CO + e	K <sub>5</sub> = 5.0 E-13	
O <sup>-</sup> + O → O <sub>3</sub> + e	K <sub>6</sub> = 3.0 E-10	
Negative ion two-body reaction		
CO <sub>3</sub> <sup>-</sup> + O → O <sub>2</sub> + CO <sub>2</sub>	K <sub>7</sub> = 8.0 E-11	[7]
O <sub>2</sub> <sup>-</sup> + O → O <sub>2</sub> + O <sup>-</sup>	K <sub>8</sub> = 1.0 E-11	
CO <sub>3</sub> <sup>-</sup> + O → CO <sub>2</sub> + O <sub>2</sub>	K <sub>9</sub> = 2.0 E-10	
Negative ion three-body reaction		
O <sup>-</sup> + CO <sub>2</sub> + M → CO <sub>3</sub> <sup>-</sup> + M	K <sub>10</sub> = 1.3 E-28	
CO <sub>3</sub> <sup>-</sup> + CO <sub>2</sub> + M → CO <sub>2</sub> <sup>-</sup> + CO <sub>2</sub>	K <sub>11</sub> = 1.5 E-29	
Neutral dissociation		
CO <sub>2</sub> + e → CO + O + e	K <sub>12</sub> = 1.4 E-11	[7]
O <sub>2</sub> + e → O + O + e	K <sub>13</sub> = 1.9 E-12	[7]
Neutral recombination		
O + CO + M → CO <sub>2</sub> + M	K <sub>14</sub> = 2.0 E-36	
O + O + M → O <sub>2</sub> + M	K <sub>15</sub> = 3.0 E-33	
O + CO → CO + O <sub>2</sub>	K <sub>16</sub> = 9.0 E-15	
O + CO + M → O <sub>3</sub> + M	K <sub>17</sub> = 5.0 E-34	
CO + O → CO <sub>2</sub> + hv	K <sub>18</sub> = 2.0 E-20	[4]
Charged particle recombination		
Electron-positive ion dissociative recombination	K <sub>19</sub> = 6.4 E-7	[7]
Positive ion-negative ion two-body recombination	K <sub>20</sub> = 2.0 E-7	
Positive ion-negative ion three-body recombination	K <sub>21</sub> = 1.0 E-25	[7]

또한 전자와의 모든 방정식[5]은

$$\frac{\partial n_e}{\partial t} = n_e n_K i - n_e n_p K_f^e - n_e n_K a + n_n n_K d + n_S$$

$K_a$  : 전자 부착 비율상수

$K_i$  : 전자 이온화 비율상수

$K_d$  : 전자 이탈 비율상수

$K_f^e$  : 전자- 양이온의 재결합 비율상수

으로 나타난다. 그리고 균일 방전에서 밖으로 확산되는 영향을 무시하고 수밀도가 각각 중류물의 생성과 소멸에 의해 형성된다고 하면 음이온과 양이온의 비율방정식은

$$\frac{\partial n_{-}}{\partial t} = n_e n_K a - n_n n_K d - n_n n_p K_{ir}$$

$$\frac{\partial n_{+}}{\partial t} = n_e n_K i - n_e n_p K_f^e - n_n n_p K_{ir}$$

$K_{ir}$  : 음이온과 양이온의 재결합 비율상수  
과같이 표현된다. 표1의 반응상수들과 전술한 방정식을 결합하여 시간전개에 대한 수밀도와 각 중류물의 수밀도를 계산할 수 있는 비율방정식을 형성하여 그 결과를 그림1과 2에 나타내었다.

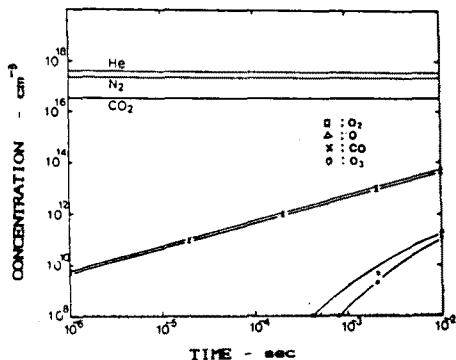


FIG. 1. Calculated temporal evolution of neutral species in a 20 torr  $\text{CO}_2$  -  $\text{N}_2$  -  $\text{He}$  mixture in the proportions 1 - 7 - 12.

그림1은  $\text{CO}_2$  -  $\text{N}_2$  -  $\text{He}$  = 1 - 7 - 12인 혼합비로 전체 20 torr일 때 중성입자들의 수밀도를 표현한 것이다.

$\text{CO}_2$ ,  $\text{N}_2$ ,  $\text{He}$  분자들의 수밀도 변화는 없는 것으로 하였으며  $\text{CO}_2$  분자와 전자의 충돌에 의한 해피반응으로 발생되는  $\text{CO}$ 와  $\text{O}$ 의 수밀도는  $10^{-6}$ 부터 선형적인 증가를 하여  $10^{-2}$  시간에서  $\text{CO}_2$  분자 수밀도의 약 0.8 %까지 된다. 또한 중성입자와 이온화의 반응에 의해 생성되는  $\text{O}_2^-$ 와  $\text{O}_3^-$ 의 수밀도는 약  $\sim 10^{11}$  정도를 갖는다. 이런 중류물은 재반응 및 전자교환에 짜증기 때문에 전자 수밀도보다 큰 수밀도를

갖는데 이러한 반응 결과는 혼합가스를 고려할 때 필요하다.

그림2는 그림1과 같은 조건에서 음이온에 대한 수밀도를 나타낸 것이다. 그림에서 알 수 있듯이 기본적인 음이온은  $\text{CO}_2$  분자에 전자가 해피부착에 의해 생성되는  $\text{O}^-$ 이다. 또한  $\text{O}^-$ 와  $\text{CO}_2$  분자와의 삼체충돌(Three body Collision)에 의해  $\text{CO}_3^-$ 을 형성하게 된다.

본 논문 조건에서는  $\text{CO}_3^-$  가 가장 큰 수밀도를 가지는 음이온임을 알 수 있었다

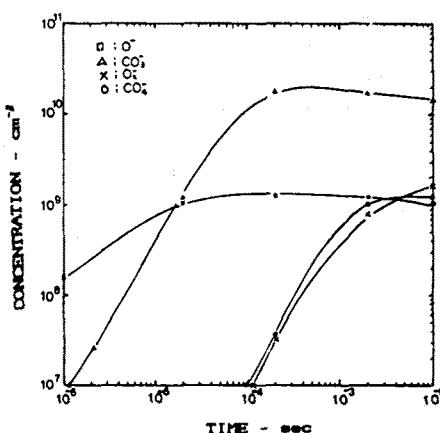


FIG. 2. Calculated temporal evolution of negative ions for the conditions of FIG. 1.

### III. 결론

전기 방전이기  $\text{CO}_2$  -  $\text{N}_2$  -  $\text{He}$  혼합가스에서  $\text{CO}_2$  분자와 해피 및 이온화에 의해 생성되는 중성입자 및 음이온들의 수밀도를 계산하였고  $\text{N}_2$  분자의 영향을 포함하였을 때의 수밀도와의 차이를 비교하였다.  $\text{N}_2$  분자에 의해 생성되는  $\text{NO}$ ,  $\text{NO}_2$ ,  $\text{N}_2\text{O}$ 의 중성입자와  $\text{NO}_2^-$ ,  $\text{NO}_3^-$ 의 음이온 수밀도를 포함시키지 않고  $\text{CO}_2$  분자만을 고려했을 때의  $\text{CO}$ ,  $\text{O}$ 의 수밀도는 20 % 정도 감소하였고  $\text{O}_2^-$ 나  $\text{O}_3^-$ 는 상당히 큰값으로 감소되었다. 또한 음이온들의 수밀도 비교에서도  $\text{CO}_3^-$ 과  $\text{O}_2^-$ 나  $\text{O}_3^-$ 의 수밀도 차이만큼 감소되었으나  $\text{O}^-$ 는 오히려 증가하였다. 이것은  $\text{CO}_2$  분자의 해피부착에 의해 생성된  $\text{O}^-$ 가  $\text{N}_2$  분자와의 반응이 있어 소멸되지 않았기 때문이다.

### IV. 참고 문헌

1. L.V.Sutter, "The Advent of Portable CO2 Laser Offers New Capabilities in Many Surgical Areas", Laser & Applications, pp101 - 104, 1985

2. "Guide to Commercial Laser" Laser & Applications, 1986
3. R.A.Haas, "Plasma Stability of Electric Discharges in Molecular Gases", Phys. Rev A8, pp1017-1043, 1973
4. W.J.Wiegand and W.L.Nighan, "Plasma Chemistry of CO<sub>2</sub>-N<sub>2</sub>-He Discharges", Appl. Phys. Lett 22, pp583-586, 1973
5. W. L.Nighan and W.T.Wiegand, "Influence of Negative -Ion Processes on Steady-State Properties and Striations in Molecular Gases Discharges", Phys. Rev A10, pp922-945, 1974
6. J.F.Prince and A.Garscadden, "Negative Ion Species in CO<sub>2</sub>-N<sub>2</sub>-He Discharge", Appl. Phys. Lett 27, pp13-15, 1975
7. H.Shields, A.L.S.Smith and B.Norris, "Negative Ion Effects in TEA CO<sub>2</sub> Laser", J. Phys. D: Appl. Phys 9, pp1587-1603, 1976
8. P.W.Pace and M.Lacombe, "A Sealed High-Repetition-Rate TEA CO<sub>2</sub> Laser", IEEE J. QE-14, pp263-274, 1978